

木村・一色研究室と上野研究室の合同セミナー プログラム

Joint-seminar between Kimura,Isshiki Lab and Ueno Lab

日時 2008 年 4 月 4 日 13:00 ~ 16:20 (3,4,5 時間目)

場所 西 2 号館 105 教室(W2-105) 定員 30 名

参加者 大学院生、研究員、一色 秀夫先生、上野 芳康先生、木村 忠正先生  
(卒研究生も聴講参加と見学参加を歓迎します!)

プログラム (発表 10 分、質疑応答 5 分以上、計 15 分以内)

先生方のみ発表 15 分 質疑応答 5 分以上 計 20 分以内)

※発表者のみの記載で、関係者の記載は省略させていただきます。

13:00 ~13:10  
ご挨拶

13:10~

1) 一色 秀夫 先生

”シリコンフォトニクスに向けた材料・デバイス開発”(20 分)

2) 上野 芳康 先生

“超高速・省エネルギーな光半導体ゲート”(20分)

3) 大江 将己 (M2)

“(仮題)Er<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>結晶の相分離形成”(15分)

4) 西田 武洋 (M2)

“(仮題)半導体キャリア冷却時定数限界を克服する高速全光ゲートモデル設計とその実験着手状況”(15分)

5) 田中 康仁 (M2)

“(仮題)レーザーアブレーション法による高配向Er<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>結晶の作製” (15分)

14:35~

休憩 14:35 ~14:45

14:45~

6) 本間 正徳 (M2)

“フォトニック結晶/量子ドット材料を利用した小型集積光導波路回路のピコ秒高速応答特性評価研究” (15分)

7) 神保 幸宏 (M2)

”ヘテロエピタキシャルダイヤモンド薄膜に関する研究” (15分)

8) 竹内 宏幸 (M2)

“超高速全光ゲートを利用したモード同期パルス発生器の、4ps, 10GHz, 単一縦モード発振” (15分)

9) Xingjun Wang (P.D)

“Erbium silicate formation process by sol-gel method.” (15分)

10) 坂口 淳 (COE研究学生)

“(仮題) 200Gb/s高速ゲート実験研究の最新状況” (15分)

16:00~16:20

まとめ、終りの挨拶等

## 備考

・本セミナー実施に関して、雑用が複数ありますが、それらについては上野研山路君 ([yamaji@ultrafast.ee.uec.ac.jp](mailto:yamaji@ultrafast.ee.uec.ac.jp)) および木村・一色研、中島君 ([nakajima@flex.ee.uec.ac.jp](mailto:nakajima@flex.ee.uec.ac.jp)) にお願ひします。

・発表スライドの1/4縮小印刷物を、当日会場で、人数分(35)配布する予定ですので各自事前に印刷していただきますようお願ひします。

この文章は上野研竹内が作成しました。不備があれば修正しますので ([takeuchi@ultrafast.ee.uec.ac.jp](mailto:takeuchi@ultrafast.ee.uec.ac.jp)) までご連絡ください。